



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.7

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

9 September 2025

Nomor : KBP/01/IX.2025/098
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202207258 yang berjudul "Peralatan Penyalut dan Metode Penyalutan"

Yth.

Prudence Jahja, S.H., LL.M.

Januar Jahja and Partners
Menara Batavia Lantai 19
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat, 10220

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 1 Februari 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 2/KBP/II/2024
Nomor Permohonan Paten : P00202207258
Judul Invensi : Peralatan Penyalut dan Metode Penyalutan
Pemohon Banding : JIANGSU FAVORED NANOTECHNOLOGY CO., LTD.,
Nomor Putusan Banding : 018.2.T/KBP-02/2025

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor 018.2.T/KBP-2/2025

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202207258 yang berjudul Peralatan Penyalut dan Metode Penyalutan dengan Nomor Registrasi 2/KBP/II/2024 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Prudence Jahja, S.H., LL.M. dari Kantor Konsultan Januar Jahja and Partners kepada Komisi Banding Paten tanggal 1 Februari 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	:	Jiangsu Favored Nanotechnology Co., Ltd.
Alamat Pemohon Banding	:	No.182 East Loop, Yuqi Industry Park Huishan District, Wuxi, Jiangsu 214000, P.R. China
Kuasa Pemohon Banding	:	Prudence Jahja, S.H., LL.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	:	Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, 10220

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202207258 beserta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- a) *Bahwa Permohonan Banding ini diajukan melalui kuasa Prudence Jahja, SH., LL.M., dari kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Januar Jahja and Partners (Bukti-P1.)*

- b) Bawa untuk mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan paten fase nasional sekaligus dengan permohonan pemeriksaan substantif atas paten yang berjudul "PERALATAN PENYALUT DAN METODE PENYALUTAN" pada tanggal 07 Juli 2022 untuk 32 klaim invensi menggunakan Hak Prioritas dari Negara China dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/CN2020/095077 tertanggal 09 Juni 2020 dengan abstrak invensi: "Invensi ini menyediakan suatu peralatan penyalut dan metode penyalutan. Peralatan penyalut mencakup bilik reaksi, rangka penopang, sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma. Rangka penopang memiliki area penopangan untuk menopang substrat. Sumber pelepasan monomer memiliki saluran masuk pelepasan untuk memasukkan bahan pembentuk penyalut sedemikian sehingga bahan pembentuk penyalut memasuki bilik reaksi. Sumber eksitasi plasma disusun untuk mengaktifkan bahan pembentuk penyalut, dan area penopangan kerangka penopang diposisikan di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, sedemikian sehingga lapisan penyalut area terbentuk secara seragam pada permukaan substrat, dan kecepatan deposisi dipercepat." Setelah melalui tahap pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan formalitas permohonan paten No. P00202207258 kemudian dipublikasikan pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Publikasi 2022/04343 dengan periode pengumuman selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada 2 Maret 2023 (Bukti-P2-P6).
- c) Bawa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202207258 diterbitkan oleh Pemeriksa pada tanggal 13 April 2023 yang pada intinya Pemeriksa menggunakan dokumen pembanding yang dianggap relevan untuk menilai patentabilitas permohonan ini sebagai berikut:

No.	Nomor Acuan	Dokumen Terkait	Kategori	Klaim Relevan
1	D1	US2005178329 A1	Y	1-32
2	D2	CN1642664 A1	Y	1-32
3	D3	CN101421825 B	Y	1-32
4	D4	CN104380435 A	Y	1-32
5	D5	CN100400183 C	Y	1-32
6	D6	US8061299 B	Y	1-32
7	D7	WO2011/029096 A2	Y	1-32
8	D8	WO0020130 A1	Y	1-32
9	D9	US6329024 B1	Y	1-32
10	D11	US6482531 B1	Y	1-32
11	D12	US9687874 B2	Y	1-32
12	D13	US9165807 B2	Y	1-32

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif Tahap Pertama, Pemeriksa berpendapat Klaim 1-32 memiliki kebaruan namun tidak mengandung langkah inventif. Pemeriksa juga menginformasikan keberatan terkait ketidakjelasan Klaim dan pengungkapan invensi (Bukti-P7).

- d) Bawa pada tanggal 11 Juli 2023 Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dimana Pemohon Banding telah mengamendemen Klaim pada permohonan paten ini dengan Klaim Amendemen terlampir sejumlah 32 klaim dan telah menyampaikan argumentasi dan penjelasan terhadap hal-hal yang dianggap oleh Pemeriksa masih terdapat kekurangan (Bukti-P8 dan Bukti-P9).
- e) Bawa kemudian Pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202207258 pada tanggal 02 November 2023 dengan dasar Klaim Amendemen 1-32 tersebut adalah tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan demikian Klaim Amendemen 1-32 tersebut dipertimbangkan ditolak (Bukti-P10).
- f) Bawa Pemohon Banding memberikan tanggapan atas keberatan pemeriksa dalam surat penolakan permohonan paten, sebagai berikut: Dengan ini Pemohon Banding menyatakan masih berkepentingan dan berkeyakinan bahwa invensi ini akan berguna dan memberikan manfaat khususnya di Indonesia. Oleh karena itu Pemohon Banding ingin mengamendemen klaim permohonan paten ini sesuai dengan Klaim Amendemen yang dilampirkan dalam surat permohonan banding ini (Bukti-P11, Bukti-P12 dan Bukti-P13), yang mana amandemen tersebut didasarkan oleh hal-hal berikut ini:
1. Bawa Pemohon Banding sangat keberatan dengan penolakan permohonan paten No. P00202207258 yang didasarkan pada Pasal 2, 3, dan 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 2. Bawa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pemeriksa yang menilai klaim-klaim pada permohonan P00202207258 dianggap tidak memiliki kebaruan dan memperluas inti invensi.
 3. Bawa Pemohon Banding masih berkepentingan dengan permohonan paten ini dan Pemohon Banding memutuskan untuk mengajukan permohonan banding ini untuk mengamendemen Klaim yang ditolak dengan Klaim Amendemen yang dilampirkan sejumlah 29 Klaim.
 4. Bawa Pemohon Banding melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim Amendemen tersebut di atas beserta deskripsi sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan dalam proses pemeriksaan.

Amendemen berdasarkan amendemen Klaim terakhir dan dukungan/dasar amendemen:

- Klaim original 1 telah diamendemen. Dukungan dapat ditemukan setidaknya melalui Klaim asli 4 dan paragraf [00109].
- Klaim original 5 (Klaim baru 4) telah diamendemen. Dukungan dapat ditemukan setidaknya melalui paragraf [0026].

- *Klaim original 19 (Klaim baru 18) telah diamendemen. Dukungan dapat ditemukan setidaknya melalui paragraf [0079] dan [0083].*
- *Klaim original 31 (Klaim baru 28) telah diamendemen. Dukungan dapat ditemukan setidaknya melalui paragraf [00121], paragraf [00126] dan Gambar 11.*
- *Klaim original 4, 29 dan 30 dihapus dan Klaim selainnya telah dinomori ulang.*
- *Tidak ada subject-matter baru yang ditambahkan.*

Klaim 1-32 ditolak karena tidak mengandung langkah inventif atas dokumen pembanding berikut:

D1: US2005178329 A1

D2: CN1642664 A1

D3: CN101421825 B

D4: CN104380435 A

D5: US8061299 B

D6: WO2011/029096 A2

D7: WO0020130 A1

D8: US6329024 B1

D9: US9687874 B2

D10: US9165807 B2

Namun demikian, Pemohon Banding dengan hormat menyampaikan bahwa Klaim 1-29 yang diamendemen memiliki kebaruan dibandingkan D1-D10 karena alasan-alasan berikut:

1. *Dari amendemen Klaim 1, area penopang dari rangka penopang untuk menopang substrat dikonfigurasikan antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, dan sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing disusun pada dua sisi berlawanan dari substrat Ketika deposisi. Artinya, substrat dihindari untuk ditempatkan tepat di bawah sumber eksitasi plasma, dan sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma dihindari untuk ditempatkan pada sisi substrat yang sama.*
2. *Dalam D1, “plasma dihasilkan dengan memanjangkan elektroda (27) keluar dari ruang (28) sehingga ditempatkan di antara target (21) dan substrat (24) di area (102). Beda potensial diberikan antara elektroda (27) dan pemanas (26) sehingga plasma terbentuk di antara keduanya” (paragraf [0045] dan [0062] dan Gambar 1). Oleh karena itu, selama operasi untuk pengendapan, substrat diposisikan di bawah elektroda yang diperluas, dan elektroda yang diperluas serta monomer berada pada sisi yang sama dari substrat, yang secara substansial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen.*
3. *D5 dan D1 termasuk dalam famili paten yang sama dan mengungkapkan Solusi teknis yang sama. Artinya, elektroda yang*

diperluas dan monomer berada pada sisi yang sama dari substrat, yang secara substansial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen.

4. Dalam D2, substrat ditempatkan di bawah elektroda yang digunakan untuk memproduksi plasma, dan bagian masukan monomer dan elektroda disusun pada sisi berlawanan yang sama dari substrat (baris 20-24, halaman 15 deskripsi dan Gambar 1), yang secara substansial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen.
5. Dalam D3, partikel logam dihamburkan oleh plasma dan diendapkan ke bagian cekung chip (W) dengan menerapkan energi bias ke platform pemuat, dan plasma serta target ditempatkan pada sisi chip yang sama (gambar 1 dan paragraf [0012]), yang secara substansial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen. Tidak ada monomer yang diajarkan dalam D3. Oleh karena itu, D3 gagal mengungkapkan hubungan monomer dan posisi antara monomer dan substrat sebagaimana disebutkan dalam Klaim 1 yang diamendemen. Faktanya, D3 mengungkapkan proses pelapisan sputter, yang secara substansial berbeda dari proses PECVD sebagaimana diungkapkan dalam Klaim 1 yang diamendemen.
6. Dalam D4, substrat ditempatkan di bawah ruang distribusi gas pertama (Sl), dan plasma serta ruang distribusi gas pertama ditempatkan pada sisi yang sama dari substrat (paragraf [0053] dan [0059], dan gambar 2-4), yang secara substantial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen.
7. Dalam D6, wilayah plasma dibentuk dengan tumpang tindih dua kolom positif, dan kolom positif (wilayah plasma) dan gas reaktif berada pada sisi yang sama dari substrat (Gambar 2 dan Gambar 3), yang secara substansial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen.
8. Dalam D7, substrat ditempatkan di bejana reaktor yang dikelilingi oleh kumparan tembaga yang digunakan untuk menghasilkan plasma di bejana reaktor, dan selama operasi monomer dan plasma didistribusikan pada sisi yang sama dari substrat (Gambar 1), yang secara substansial berbeda dari Klaim 1 yang diamendemen.
9. D8-D10 tidak membahas hubungan posisi antara substrat, sumber pelepasan monomer, dan sumber eksitasi plasma.
10. Mengingat hal di atas, tidak satu pun dari D1-D10 yang mengungkapkan bahwa substrat dikonfigurasi antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, dan bahwa sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing disusun pada dua sisi berlawanan dari substrat saat deposisi. Oleh karena itu, Klaim 1 yang diamendemen memiliki setidaknya fitur-fitur yang berbeda sebagai berikut: rangka penopang yang memiliki area penopang untuk menopang substrat di dalam bilik reaksi dari bodi bilik; dimana area penopang dari rangka penopang diposisikan pada posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma sedemikian cara sehingga substrat dikonfigurasi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, dan

sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing disusun pada dua sisi yang berlawanan dari substrat ketika deposisi.

11. Oleh karena itu, Klaim 1 yang diamendemen memiliki kebaruan dibandingkan dengan D1-D10 secara terpisah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Klaim-klaim permohonan ini memenuhi kriteria kebaruan dan dapat dipertimbangkan untuk diberi paten di Indonesia berdasarkan UU Paten.

Sebagaimana disebutkan di atas, Klaim amendemen 1 memiliki fitur-fitur pembeda di atas. Pemeriksa menyebutkan bahwa: ... sehingga penyalut polimer terbentuk pada permukaan substrat serta dengan alat penggerak ataupun memutar komponen peralatan penyalutan yang untuk mengatur jarak pelepasan bahan monomer dengan alat penyalut dan juga dengan sumber eksitasi, dan yang bisa memutar/ merotasi peralatan tersebut,....

Akan tetapi, argumen Pemeriksa tersebut tidak berdasar. Semua dokumen D1-D10 tidak mengungkapkan hubungan kualitas penyalutan dan proporsi monomer yang dieksitasi pada monomer yang tidak terdekomposisi, dan tidak mengungkapkan hubungan antara kualitas penyalutan dan hubungan posisi di antara substrat, sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma. Seseorang yang ahli di bidang tersebut tidak akan mendapat petunjuk atau motivasi untuk mengonfigurasi posisi substrat, sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma seperti dalam Klaim amendemen 1 berdasarkan penjelasan dalam dokumen D1-D10.

Dengan menyusun area penopang dari rangka penopang di posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma dalam keadaan dimana substrat dikonfigurasikan di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, dan menyusun sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma di kedua sisi yang berlawanan dari substrat, suatu proporsi monomer yang mencapai sumber eksitasi plasma ke monomer yang belum terdekomposisi dalam spesies prekursor reaktif yang dapat disesuaikan, dimana hal ini membantu meningkatkan kualitas polimer penyalut yang terbentuk pada substrat. Akan tetapi, dokumen D1-D10 tidak dapat mencapai efek teknis tersebut.

Oleh karena itu, dokumen D1-D10 berbeda secara substansial dari Klaim amendemen 1, dan dokumen D1-D10 secara terpisah atau bersama-sama, seseorang yang ahli di bidang tersebut tidak dapat sampai pada solusi seperti yang disebutkan dalam Klaim amendemen 1.

Oleh karena itu, Klaim amendemen 1 mengandung langkah inventif terhadap dokumen D1-D10.

Klaim amendemen 2-17 merupakan turunan Klaim amendemen 1. Bawa karena Klaim amendemen 1 mengandung langkah inventif, maka Klaim amendemen 2-17 mengandung langkah inventif pula.

Klaim amendemen 18 adalah Klaim mandiri dan telah ditambahkan fitur-fitur serupa dan Klaim amendemen 18 telah setidaknya memiliki fitur-fitur pembeda terhadap dokumen D1-D10 sebagai berikut: menyusun substrat dalam bilik reaksi pada bodi bilik di posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, dan menyusun sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma pada interval dalam bilik reaksi pada dua sisi yang berlawanan dari bilik reaksi pada bodi bilik, dimana sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing disusun pada dua sisi dari satu atau lebih substrat.

Dengan menyusun substrat dalam sebuah bilik reaksi dari bodi bilik pada suatu posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, dan menyusun sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing di kedua sisi yang berlawanan dari substrat, suatu proporsi monomer yang mencapai sumber eksitasi plasma ke monomer yang belum terdekomposisi dalam spesies prekursor reaktif yang dapat disesuaikan, dimana hal ini membantu meningkatkan kualitas polimer penyalut yang terbentuk pada substrat. Akan tetapi, dokumen D1-D10 tidak dapat mencapai efek teknis tersebut.

Untuk alasan serupa, Klaim amendemen 18 dan Klaim-klaim turunannya (Klaim amendemen 19-27) mengandung langkah inventif.

Klaim amendemen 28 adalah Klaim mandiri dan telah ditambahkan fitur-fitur serupa, dan Klaim amendemen 18 setidaknya memiliki fitur-fitur pembeda terhadap dokumen D1-D10 sebagai berikut: medan eksitasi plasma dan sedikitnya satu sumber monomer masing-masing diletakkan pada dua sisi yang berlawanan dari area penyalutan dimana bracket menopang substrat ketika deposisi.

Dengan menyusun medan eksitasi plasma dan setidaknya satu sumber monomer masing-masing ditempatkan pada kedua sisi yang berlawanan dari area penyalutan dimana bracket menopang substrat ketika deposisi, suatu proporsi monomer yang mencapai sumber eksitasi plasma ke monomer yang belum terdekomposisi dalam spesies prekursor reaktif yang dapat disesuaikan, dimana hal ini membantu meningkatkan kualitas polimer penyalut yang terbentuk pada substrat. Akan tetapi, dokumen D1-D10 tidak dapat mencapai efek teknis tersebut.

Untuk setidaknya alasan serupa, Klaim amendemen 28 dan Klaim yang bergantung kepadanya (Klaim amendemen 29) mengandung langkah inventif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Klaim-Klaim permohonan ini mengandung langkah inventif dan memenuhi kriteria untuk dapat diberi paten di Indonesia berdasarkan UU Paten.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Komisi Banding Paten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Penolakan Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202207258 tanggal 02 November 2023; dan
3. Memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk memutuskan Klaim-klaim pada permohonan ini dapat diberi paten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak permohonan patennya pada tanggal 2 November 2023 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202207258 dengan judul Peralatan Penyalut dan Metode Penyalutan diajukan pada tanggal 1 Februari 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa spesifikasi permohonan paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202207258 tanggal 2 November 2023 ialah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor JJP/P/PJ/RA/23-01390 tanggal 11 Juli 2023 dengan judul Peralatan Penyalut dan Metode Penyalutan dengan rincian terdiri atas Deskripsi 50 halaman, Klaim 1-32, Abstrak, dan Gambar 1-15.
3. Menimbang bahwa Pemohon melakukan amandemen klaim menjadi 29 klaim sebagai tanggapan atas surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202207258 tanggal 2 November 2023 sebagaimana dilampirkan dalam Permohonan Banding. Majelis Banding menilai bahwa amandemen klaim tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, sehingga yang menjadi objek banding ialah spesifikasi permohonan paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202207258 tanggal 2 November 2023 yaitu spesifikasi permohonan paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor JJP/P/PJ/RA/23-01390 tanggal 11 Juli 2023.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.

- a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202207258 tanggal 2 November 2023 ialah
1. *Suatu peralatan penyalut untuk membentuk penyalut pada permukaan substrat, yang meliputi:*
bodi bilik yang memiliki bilik reaksi yang dilengkapi dengan area pemasok substrat untuk menempatkan substrat;
sumber pelepasan monomer yang memiliki saluran masuk pelepasan untuk memasukkan bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi pada bodi bilik; dan
sumber eksitasi plasma yang diposisikan pada bilik reaksi pada bodi bilik untuk mengeksitasi bahan pembentuk penyalut,
dimana area pemasok substrat dikonfigurasi pada posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma sedemikian cara sehingga substrat disesuaikan untuk disusun di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, sehingga selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber pelepasan monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar sumber eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai sumber eksitasi plasma.
 2. *Peralatan penyalut menurut klaim 1, dimana jenis lucutan listrik dari sumber eksitasi plasma dipilih dari satu atau lebih kombinasi berikut: arus langsung, lucutan arus bolakbalik, lucutan frekuensi audio, lucutan frekuensi radio, lucutan gelombang mikro, lucutan frekuensi sedang, lucutan Penning, lucutan percik dan lucutan pulsa.*
 3. *Peralatan penyalut menurut klaim 1, lebih lanjut meliputi unit pemasok monomer yang meliputi alat penyimpan bahan untuk menyimpan bahan baku dari bahan pembentuk penyalut, dan vaporizer untuk menguapkan bahan baku untuk membentuk uap monomer dari bahan pembentuk penyalut; atau peralatan penyalut lebih lanjut meliputi unit pemasok monomer, dimana unit pemasok monomer meliputi alat penyimpan bahan yang dihubungkan dengan sumber pelepasan monomer untuk menyimpan monomer gas dari bahan pembentuk penyalut.*
 4. *Peralatan penyalut menurut klaim 1, lebih lanjut meliputi: rangka penopang yang memiliki area penopangan untuk menopang substrat di dalam bilik reaksi pada bodi bilik; dimana area penopangan pada rangka penopang diposisikan pada posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma sedemikian cara sehingga substrat dikonfigurasi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma.*

5. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana rangka penopang dikonfigurasi dalam bilik reaksi pada bodi bilik di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma.
6. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana rangka penopang dapat dioperasikan untuk bergerak dalam bilik reaksi pada bodi bilik di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma.
7. Peralatan penyalut menurut klaim 6, dimana gerakan rangka penopang dipilih dari satu atau lebih kombinasi berikut: gerakan linear, gerakan melengkung, gerakan bergeser dan gerakan berotasi.
8. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana sumber eksitasi plasma dikonfigurasikan pada bodi bilik berada jauh dan diberi jarak dari sumber pelepasan monomer; atau sumber eksitasi plasma dikonfigurasikan pada rangka penopang di sisi rangka penopang yang berlawanan dengan sumber pelepasan monomer.
9. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana bodi bilik memiliki dua dinding samping yang berlawanan dengan satu sama lain, dan sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing ditempatkan dalam bilik reaksi pada bodi bilik di posisi yang berdekatan dengan dua dinding samping yang berlawanan dengan satu sama lain; atau dimana bodi bilik memiliki dua dinding samping yang berdekatan, dan sumber pembentukan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing ditempatkan dalam bilik reaksi pada bodi bilik di posisi yang berdekatan dengan dua dinding samping yang berdekatan dari bodi bilik.
10. Peralatan penyalut menurut klaim 5, dimana bodi bilik memiliki dinding samping, serta sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma ditempatkan dalam bilik reaksi pada bodi bilik di posisi yang berdekatan dengan dinding samping dari bodi bilik dan berada jauh dan diberi jarak dari satu sama lain.
11. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana sumber eksitasi plasma meliputi sarana elektrode untuk menerapkan daya listrik pada bahan pembentuk penyalut, dan sarana elektrode meliputi sepasang elektrode untuk melakukan lucutan frekuensi radio atau elektrode planar yang membentang dalam bilik reaksi.
12. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana penampang melintang bilik reaksi pada bodi bilik dipilih dari kelompok yang terdiri dari bentuk lingkaran, bentuk oval, dan bentuk polygonal.
13. Peralatan penyalut menurut klaim 4, dimana rangka penopang meliputi sejumlah area penopangan yang disusun di sekitar sumber eksitasi plasma untuk menopang sejumlah substrat.
14. Peralatan penyalut menurut klaim 13, dimana rangka penopang meliputi rangka pembawa yang memiliki sejumlah area penopang, dimana rangka pembawa dapat dioperasikan untuk

berotasi pada sumbu pusatnya mengitari sumber eksitasi plasma.

15. Peralatan penyalut menurut klaim 13, dimana rangka penopang meliputi rangka yang dapat digerakkan yang dapat dioperasikan untuk berotasi pada sumbu pusat bodi bilik dan rangka pembawa yang memiliki sejumlah area penopang, dan rangka pembawa dikonfigurasikan pada rangka yang dapat digerakkan dan dapat dioperasikan untuk berotasi pada sumbu pusat rangka yang dapat digerakkan mengitari sumber eksitasi plasma.
16. Peralatan penyalut menurut klaim 13, dimana sumber eksitasi plasma meliputi sarana elektrode untuk menerapkan daya listrik pada bahan pembentuk penyalut, sarana elektrode meliputi sejumlah elektrode pertama dan sejumlah elektrode kedua yang disusun selang-seling di sepanjang arah keliling sebagai elektrode positif dan negatif, dan setiap elektrode pertama dan elektrode kedua adalah pelat electrode.
17. Peralatan penyalut menurut klaim 13, dimana sumber eksitasi plasma meliputi sarana elektrode untuk menerapkan daya listrik pada bahan pembentuk penyalut, sarana elektrode meliputi sejumlah elektrode pertama dan sejumlah elektrode kedua yang berperan sebagai elektrode positif dan negatif, dan setiap elektrode pertama dan elektrode kedua adalah elektrode silinder dan elektrode pertama menyelubungi elektrode kedua.
18. Peralatan penyalut menurut klaim 17, dimana elektrode kedua lebih lanjut berperan sebagai pipa pemompa yang dihubungkan dengan sisi luar bilik reaksi pada bodi bilik.
19. Suatu metode penyalutan untuk membentuk penyalut pada permukaan substrat, yang meliputi:
 - (a) menyusun substrat dalam bilik reaksi pada bodi bilik di posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma; dan
 - (b) memasukkan bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi melalui sumber pelepasan monomer untuk membentuk penyalut polimer pada permukaan substrat dalam pengaruh sumber eksitasi plasma,
dimana selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber pelepasan monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar sumber eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai sumber eksitasi plasma.
20. Metode penyalut menurut klaim 19, lebih lanjut meliputi: secara berulang memindahkan substrat di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma; atau merotasikan substrat mengitari sumber eksitasi plasma.
21. Metode penyalut menurut klaim 19, lebih lanjut meliputi:

memasukkan bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi dari satu sisi bilik reaksi ke arah sisi lainnya yang berlawanan melalui sumber pelepasan monomer; atau

memasukkan bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi dari periferi bilik reaksi melalui sejumlah sumber pelepasan monomer; atau

memasukkan bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi dari sisi atas bilik reaksi melalui sumber pelepasan monomer.

22. Metode penyalut menurut klaim 19, lebih lanjut meliputi: menguapkan bahan baku untuk membentuk bahan pembentuk penyalut sebagai uap monomer, dan mentransmisikan bahan pembentuk penyalut ke sumber pelepasan monomer, sehingga memasok bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi pada bodi bilik".
23. Metode penyalut menurut klaim 19, lebih lanjut meliputi: mentransmisikan bahan pembentuk penyalut gas ke sumber pelepasan monomer, sehingga memasok bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi pada bodi bilik.
24. Metode penyalut menurut klaim 19, lebih lanjut meliputi: mengelilingi sumber eksitasi plasma dengan sejumlah substrat, dan menyusun secara melingkar sejumlah sumber pelepasan monomer untuk melepaskan bahan pembentuk penyalut ke arah sumber eksitasi plasma pada arah radial bilik reaksi.
25. Metode penyalut menurut klaim 24, lebih lanjut meliputi: merotasikan rangka yang dapat digerakkan pada sumbu pusat bodi bilik, dan sejumlah substrat ditopang oleh rangka pembawa yang dikonfigurasikan pada rangka yang dapat digerakkan.
26. Metode penyalut menurut klaim 25, lebih lanjut meliputi: menggerakkan rangka pembawa, dan rangka pembawa dan rangka yang dapat digerakkan relatif terhadap satu sama lain.
27. Metode penyalut menurut klaim 26, dimana rangka pembawa dikonfigurasikan pada rangka yang dapat digerakkan dan dapat dioperasikan untuk berotasi pada sumbu pusatnya".
28. Metode penyalut menurut klaim 19, lebih lanjut meliputi: menggerakkan substrat dalam bilik reaksi pada bodi bilik untuk menentukan jalur pergerakan substrat, dimana pada sedikitnya sebagian jalur pergerakan, substrat terletak pada posisi di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma.
29. Metode penyalut menurut klaim 28, dimana jalur pergerakan substrat dapat meliputi bagian pertama dan bagian kedua, pada bagian pertama, sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma masing-masing terletak pada dua sisi substrat; dan pada bagian kedua, sumber pelepasan monomer dan substrat masing-masing terletak pada dua sisi sumber eksitasi plasma; atau pada bagian kedua, sumber eksitasi plasma dan substrat masing-masing terletak pada dua sisi sumber pelepasan monomer.

30. Metode penyalut menurut klaim 29, dimana bagian pertama jalur pergerakan lebih besar daripada bagian kedua jalur pergerakan.
31. Suatu peralatan penyalut, yang meliputi:
- bilik penyalutan;
 - sedikitnya satu braket yang dikonfigurasikan pada bilik penyalutan, dimana braket dilengkapi dengan unit penopang untuk menopang substrat;
 - sedikitnya satu sumber monomer yang dihubungkan dengan bilik penyalutan dan yang digunakan untuk memasukkan monomer gas atau uap monomer ke dalam bilik penyalutan;
 - medan eksitasi plasma yang disediakan pada bilik penyalutan dan yang digunakan untuk mengaktifkan monomer gas atau uap monomer,
- dimana unit penopang dari braket dapat secara relatif bolak-balik mendekati dan menjauh dari medan eksitasi plasma, sehingga membuat penyalut pada permukaan substrat, sehingga selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar medan eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai medan eksitasi plasma.
32. Peralatan penyalut menurut klaim 31, dimana braket dikonfigurasikan untuk menopang dan menggerakkan substrat maju mundur antara medan eksitasi plasma dan sumber monomer; atau braket dikonfigurasi untuk menopang dan mengayun substrat maju mundur antara medan eksitasi plasma dan sumber monomer; atau braket dikonfigurasi untuk menopang dan menggerakkan substrat untuk melakukan gerakan melingkar elips di antara medan eksitasi plasma dan sumber monomer; atau braket dikonfigurasi untuk menopang dan menggerakkan substrat untuk melakukan gerakan bola di antara medan eksitasi plasma dan sumber monomer; atau braket dikonfigurasi untuk menopang dan menggerakkan substrat untuk melakukan gerakan planet di antara medan eksitasi plasma dan sumber monomer.
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 32, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut.
1. Klaim 1 dinilai tidak jelas, karena Klaim 1 merupakan klaim mandiri yang berkaitan dengan peralatan yang hanya mendefinisikan invensi dengan mengacu pada fitur penggunaan peralatan tersebut, sehingga tidak ada batasan struktural yang jelas yang dapat dijadikan fitur pembatas dari peralatan sesuai Klaim 1 tersebut. Fitur yang ada pada Klaim 1 ialah

“bodi bilik yang memiliki bilik reaksi yang dilengkapi dengan area pemasian substrat untuk menempatkan substrat; sumber pelepasan monomer yang memiliki saluran masuk pelepasan untuk memasukkan bahan pembentuk penyalut ke dalam bilik reaksi pada bodi bilik; dan sumber eksitasi plasma yang diposisikan pada bilik reaksi pada bodi bilik untuk mengeksitasi bahan pembentuk penyalut, dimana area pemasian substrat dikonfigurasi pada posisi diantara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma sedemikian cara sehingga substrat disesuaikan untuk disusun di antara sumber pelepasan monomer dan sumber eksitasi plasma, sehingga selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber pelepasan monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar sumber eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai sumber eksitasi plasma”.

Selain itu, frasa *“sehingga selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber pelepasan monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar sumber eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai sumber eksitasi plasma”* yang ada pada Klaim 1 tersebut tidak ada atau tidak pernah diungkapkan dalam deskripsi, sehingga Klaim 1 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi. Selanjutnya, frasa pada Klaim 1 tersebut juga hanya mendefinisikan dengan hasil yang akan dicapai. Oleh karenanya, Klaim 1 dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.

2. Klaim 2 sampai dengan Klaim 4 merupakan klaim turunan dari Klaim 1 yang dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 2 sampai dengan Klaim 4 juga dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.
3. Kaim 5, Klaim 6, Klaim 8, Klaim 9, Klaim 11, Klaim 12, dan Klaim 13 merupakan klaim turunan dari Klaim 4 yang dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 5, Klaim 6, Klaim 8, Klaim 9, Klaim 11, Klaim 12, dan Klaim 13 juga dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.
4. Kaim 7 merupakan klaim turunan dari Klaim 6 yang dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 7 juga dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.
5. Kaim 10 merupakan klaim turunan dari Klaim 5 yang dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 10 juga dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.
6. Kaim 14 sampai dengan Klaim 17 merupakan klaim turunan dari Klaim 13 yang dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 14 sampai dengan Klaim 17 juga dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.

7. Kaim 18 merupakan klaim turunan dari Klaim 17 yang dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 18 juga dinilai tidak jelas dan tidak didukung oleh deskripsi.
8. Klaim 19 merupakan klaim mandiri yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi karena frasa *“dimana selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber pelepasan monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar sumber eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai sumber eksitasi plasma”* yang ada pada Klaim 19 tidak ada atau tidak pernah diungkapkan dalam deskripsi.
9. Klaim 20 sampai dengan Klaim 24, dan Klaim 28 merupakan klaim turunan yang mengacu ke Klaim 19 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 20 sampai dengan Klaim 24, dan Klaim 28 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.
10. Klaim 25 merupakan klaim turunan yang mengacu ke Klaim 24 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 25 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.
11. Klaim 26 merupakan klaim turunan yang mengacu ke Klaim 25 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 26 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.
12. Klaim 27 merupakan klaim turunan dari Klaim 26 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 27 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.
13. Klaim 29 merupakan klaim turunan dari Klaim 28 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 29 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.
14. Klaim 30 merupakan klaim turunan dari Klaim 29 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 30 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.
15. Klaim 31 merupakan klaim mandiri yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi karena frasa *“sehingga selama operasi, area monomer terbentuk di depan sumber monomer, area penghasil plasma terbentuk di sekitar medan eksitasi plasma, substrat disusun di antara area monomer dan area penghasil plasma, dan sebagian bahan pembentuk penyalut harus melewati substrat sebelum mencapai medan eksitasi plasma”* tidak ada atau tidak pernah diungkapkan dalam deskripsi.
16. Klaim 32 merupakan klaim turunan dari Klaim 31 yang dinilai tidak didukung oleh deskripsi, sehingga Klaim 32 juga dinilai tidak didukung oleh deskripsi.

Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, karena Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dinilai tidak jelas, maka terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 tidak dapat diperiksa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapannya dalam industri.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada Angka 1 sampai dengan Angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 2/KBP/II/2024 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202207258 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menolak Klaim 1 sampai dengan Klaim 32 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 2/KBP/II/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202207258 dengan judul Peralatan Penyalut dan Metode Penyalutan;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Erlina Susilawati, M.H. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Dr. Bambang Widyatmoko, M. Eng., dan Adi Supanto, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. tidak dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

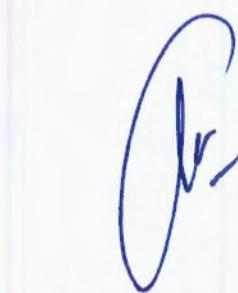
Jakarta, 28 Agustus 2025

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati. M.H.

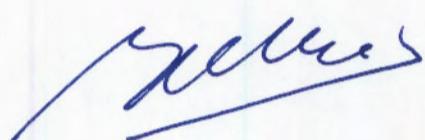
Anggota Majelis



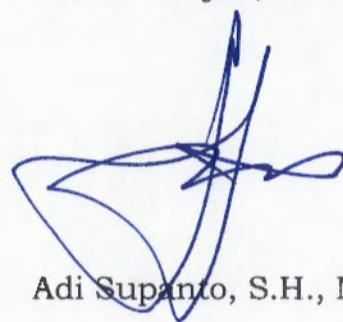
M. Adril Husni, S.T., M.M.



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Dr. Bambang Widyatmoko, M.Eng.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.